【サービスエンジニア】海外担当/メンテ/顧客対応/不具合対応 ※海外出張あり

募集職種

採用企業名
株式会社エリオニクス

求人ID
1414500

部署名
営業本部 海外営業部

業種
機械

会社の種類
中小企業 (従業員300名以下)

外国人の割合
(ほぼ) 全員日本人

雇用形態
正社員

勤務地
その他東京, 八王子市

最寄駅
横浜線、　八王子駅

給与
450万円 ~ 750万円

ボーナス
給与： ボーナス込み

勤務時間
8：30 ~ 17：30　休憩時間70分

休日・休暇
年間休日128日、完全週休二日制、年末年始、GW、夏季休暇、リフレッシュ休暇

更新日
2026年11月20日 00:00

応募必要条件

職務経験
1年以上

キャリアレベル
中途経験者レベル

英語レベル
日常会話レベル

日本語レベル
ネイティブレベル

最終学歴
短大卒： 準学士号

現在のビザ
日本での就労許可が必要です

募集要項

当社は【ナノテクノロジー】の研究開発向けの装置を開発・製造している理化学機器メーカーです。
電子・イオン等を利用したナノスケールでの加工・観察・測定機器を開発・製造・販売・サービスまでを一貫として行っています。

◆2014年「グローバルニッチトップ100選」選出
◆東京都ベンチャー技術大賞受賞　などその他多数受賞歴あり

当社の主力製品である電子ビーム描画装置は、ナノスケールの微細構造を形成する研究開発・半導体製造に欠かせない装置です。1997年には世界で初めて10nm描画を実現し、その後も5nm保証、4nm以下へと進化を続け、現在では最小線幅3nmの描画を可能とするなど、超高精細描画の限界に挑み続けています。

〇仕事の内容

最先端ナノテクノロジー研究に貢献する理化学機器メーカーである当社にて、海外担当として装置の定期メンテナンス、顧客サポート、不具合対応などをお任せします。

【製品情報】

微細加工装置(電子ビーム描画装置。例：LSIの基板に回路を描く。応用分野：光集積回路・SAWデバイス・量子効果素子・超伝導素子・ホログラム・センサーデバイス）

【出張先】

北欧・北米・台湾・韓国・シンガポール・オーストラリアなどの大学等の研究施設が中心

【出張頻度】

短期 1週間～1か月、長期2か月～3か月程度。出張時以外は、社内準備（社内開発・生産部と新製品の検査など）がメイン。

スキル・資格

【いずれも必須】
■何かしらの機械や装置のメンテナンス経験

■ビジネスレベルの英語力

【働き方】年休128日、残業20時間程度、7:30～9:30の間で30分毎の時差出勤が可能です

【魅力】
■保守メンテナンス作業だけでなく、現場からのニーズや改善を開発部門にフィードバックすることで
、開発部門と顧客を結ぶ役割を担うことができ、やりがいがあります。
また、弊社の対峙している顧客は、世界の半導体デバイスの先端を担っている方が多いので、最先端のデバイス開発に貢献している実感も持つこともできます。

勤務地
本社　東京都八王子市元横山町3-7-6
最寄駅　京王電鉄京王線京王八王子駅 徒歩15分
喫煙環境　屋内禁煙（屋外喫煙可能場所あり）
備考　JR線/京王線「八王子駅」　徒歩15分

勤務地備考
車通勤不可。八王子駅から徒歩もしくは自転車(駐輪場有)で通勤が多数。大通りが経路となるため夜も明るく、飽きずに歩けます。
転勤：無

雇用形態
正社員 無
試用期間：有 3ヶ月（試用期間中の勤務条件：変更無）

給与
想定年収 470万円～750万円
月給制 月給 280,000円～
■賞与実績:年2回6・12月

就業時間
時差勤務制（ 所定労働時間 07時間 50 分）

休憩70分（10：00、15：00に10分休憩、11：55～12：45で50分休憩）
残業：有
平均残業時間：20時間
残業手当：有 残業時間に応じて別途支給

通勤手当
会社規定に基づき支給

社会保険
健康保険：有 厚生年金：有 雇用保険：有 労災保険：有

休日・休暇
年間 128日 完全週休二日制 土曜 日曜 祝日
年末年始4日 その他（社内カレンダー）
有給休暇 入社直後2日 半年経過時点8日の計10日/法令に基づく

その他勤務条件に関する備考
■賞与実績:年2回

その他制度
企業年金/社員持株会/【家族手当】子供1人につき5000円※規定により支給
寮・社宅：無
退職金 有

制度備考
★家族手当有
★役職手当有

選考内容
面接回数：1～2回
備考：筆記試験：無
英語で軽い質問をさせていただく場合あり。

会社説明

エリオニクスは、1975年の創立以来、常に最先端の科学技術の進歩に貢献する装置作りを目指して、ナノテクノロジーの研究開発用装置を世に送り出してきました。

電子ビーム描画装置では、1997年に、当時の最高スペックを1/5にした線幅10nmを描ける超高精細電子線描画装置を開発、その後も次々に世界最高性能の装置を開発してきました。

2つのCS「Challenge　and　Speed」「Customer　Satisfaction」を基本姿勢として、常に他社に先駆けた装置開発を行っており、それが現在までナノテク研究用装置メーカーとしてトップランナーであり続けられた理由であると考えております。

研究開発用装置は日本国内及び、世界の大学・公的機関などにも導入され、高い評価を受けておりますが、今後は研究開発から事業化に向けた生産用装置の開発・販売にも注力してまいります。

私たちはこれからも世界中の皆様の課題解決のパートナーとして、最高性能の装置、最高の顧客満足を提供する世界ブランドの企業を目指してまいります。